【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成19年9月13日(2007.9.13)

【公開番号】特開2006-66181(P2006-66181A)
【公開日】平成18年3月9日(2006.3.9)
【年通号数】公開・登録公報2006-010
【出願番号】特願2004-246468(P2004-246468)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｊ　37/244　(2006.01)
Ｈ０１Ｊ　37/28　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/66　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｊ　37/244
Ｈ０１Ｊ　37/28　Ｂ
Ｈ０１Ｌ　21/66　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成19年8月1日(2007.8.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子銃から放出された電子線を成形して試料面上に照射する照射光学系と、前記試料から放出された二次電子を検出系に結像する写像投影光学系とを備えた電子線装置の信号取り出し方法において、
前記写像投影光学系には二次電子の像を光信号に変換するシンチレータ及び光学部材を設け、前記光学部材の真空側を平面としかつ該平面に前記シンチレータを設け、前記光学部材の大気側を曲面とし、前記シンチレータにより形成された光信号を前記曲面を通して大気側に取り出すことを特徴とする、信号取り出し方法。
【請求項２】
電子銃から放出された電子線を成形して試料面上に照射する照射光学系と、前記試料から放出された二次電子を検出系に結像する写像投影光学系とを備えた電子線装置において、
前記写像投影光学系には二次電子の像を光信号に変換するシンチレータ及び光学部材を設け、前記光学部材の真空側を平面としかつ該平面に前記シンチレータを設け、前記光学部材の大気側を曲面とし、前記シンチレータにより形成された光信号を前記曲面を通して大気側に取り出すようにしたことを特徴とする、電子線装置。
【請求項３】
請求項２に記載の電子線装置を使用してプロセス途中のウェハの評価を行うことを特徴とする、デバイス製造方法。